(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 13. Januar 2005 (13.01.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/004244 A2

GMBH [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regens-

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DB2004/001344

(22) Internationales Anmeldedatum:

(51) Internationale Patentklassifikation7:

25. Juni 2004 (25.06.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

H01L 33/00

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität: 103 29 079.6 27. Juni 2003 (27.06.2003)

Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS (72) Erfinder: und

burg (DE).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUTENDEICH, Rainer [DE/DE]; Ziegetsdorfer Strassc 118, 93051 Regensburg (DE). LINDER, Norbert [DE/DE]; Keilbergstrasse 31, 93173 Wenzenbach (DE). MAYER, Bernd [DE/DE]; Roter Brachweg 138, 93049 Regensburg (DE). PIETZONKA, Ines [DE/DE]; Franz-von-Taxis-Ring 2, 93049 Regensburg (DB).

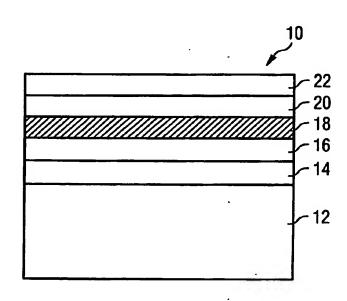
(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATEN-TANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestlimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: RADIATION-EMITTING SEMI-CONDUCTOR COMPONENT

(54) Bezeichnung: STRAHLUNGSEMITTIERENDES HALBLEITERBAUELEMENT



(57) Abstract: The invention relates to a radiation-emitting semi-conductor element provided with a layered structure. comprising an n-doped confinement layer (14), a p-doped confinement layer (22), and an active layer (18) emitting photons, said layer being arranged between the n-doped confinement layer (14) and the p-doped confinement layer (22). According to the invention, the n-doped confinement layer (14) is doped with a first n-dopant (or two n-dopants which are different from each other) in order to produce a high active doping and a precise doping profile, and the active layer (18) is doped with exclusively one second n dopant, which is different form the first dopant, in order to improve the layer quality of the active layer (18).

(57) Zusammenfassung: Bei einem strahlungsemittierenden Halbleiterbauelement mit einer Schichtstruktur, die eine n-dotierte Confinementschicht (14), eine p-dotierte Confinementschicht (22), und eine zwischen der n-dotierten

Confinementschicht (14) und der p-dotierten Confinementschicht (22) angeordnete aktive, Photonen emittlerende Schicht (18) enthält, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die n-dotierte Confinementschicht (14) mit einem ersten n-Dotierstoff (oder zwei voneinander verschiedenen n-Dotierstoffen) zur Erzeugung einer hohen aktiven Dotierung und eines scharfen Dotierprofils dotiert ist, und die aktive Schicht (18) mit nur einem von dem ersten Dotterstoff verschiedenen zweiten n-Dotterstoff zur Verbesserung der Schichtqualität der aktiven Schicht (18) dotiert ist.